Cu₂ZnSnS₄/Si 异质结器件的制备及特性研究*

李琳,文亚南,董 燕,汪壮兵,梁 齐

(合肥工业大学电子科学与应用物理学院,安徽 合肥 230009)

摘 要:利用脉冲激光沉积法在不同电阻率的 n型 Si(100)基片上沉积 Cu₂ZnSnS₄ 薄膜,制备 p-Cu₂ZnSnS₄/n-Si 异质结。利用 X 射线衍射(XRD)、X 射线能谱(EDS) 和原子力显微镜(AFM)对 Cu₂ZnSnS₄ 薄膜的结构、组 分和形貌进行表征,并对器件进行 I-V 测试,讨论不同电阻率的 Si 对异质结器件光电特性的影响。结 果表明,器件有良好的整流特性,Si 电阻率大的器件光电响应比较好,而 Si 电阻率小的器件光伏效应 比较明显。 关键词:脉冲激光沉积;Cu₂ZnSnS₄/Si 异质结;I-V 特性

中图分类号:0447;0448 文献标识码:A 文章编号:1002-0322(2012)05-0045-04

Fabrication and characterization of Cu₂ZnSnS₄/Si heterojunction devices

LI Lin, WEN Ya-nan, DONG Yan, WANG Zhuang-bing, LIANG Qi

(School of Electronic Science and Applied Physics, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

Abstract: Cu_2ZnSnS_4 thin films were deposited on n-Si(100) substrates with different resistivities by pulsed laser deposition, and the $p-Cu_2ZnSnS_4/n-Si$ heterojunctions were fabricated. The structure, composition and morphology of Cu_2ZnSnS_4 films were characterized by X-ray diffraction, energy dispersive spectrometry and atomic force microscopy. I-V characteristics of the devices show that the different resistivities of silicon substrates have a significant influence on the device performance. The devices have good rectifying characteristics and the device with high resistivity of Si has more significant photoelectric response , while the device with low resistivity of Si has more obvious photovoltaic effect.

Key words: Pulsed laser deposition; Cu₂ZnSnS₄/Si heterojunction; I-V characteristics

Cu₂Zn Sn S₄ (CZTS)是一种具有黝锡矿结构的 四元化合物,其禁带宽度为 1.4 eV~1.5 eV^[1-3],这 与太阳电池所要求的禁带宽度(1.5 eV)相匹配, 且有超过 10⁴ cm⁻¹ 的吸收系数^[4,5],另外 CZTS 薄 膜的组成成分含量丰富且是无毒的^[6-8],因而它成 为最具潜力的新型薄膜太阳能电池吸收层材料。 目前制备 CZTS 薄膜的方法有很多,例如,真空蒸 镀^[9],直流溅射^[10],电子束蒸发^[11],磁控溅射^[12,13], 脉冲激光沉积^[14-16]等。其中,脉冲激光沉积(PLD) 法在制备含有复杂化学成分薄膜的过程中,具有 易于保证薄膜与靶材的化学成分一致、生长快和 薄膜结晶性好等优点^[14]。本文利用 PLD 法制备 CZTS 薄膜。 CZTS 材料在制备光电器件和太阳电池的吸 收层方面有很好的发展前途^[3,4],所以关于用 CZTS 薄膜制备异质结的研究越来越受到人们的关注。 目前已经有一些关于此类异质结的制备以及特 性的研究报道,但多为 CZTS/CdS 异质结^[6,11,17,18], 如文献[6]是通过硫化不同的金属和金属硫化物 多层薄膜前驱体来制备 CZTS 薄膜,从而制备不 同的 CZTS/CdS 异质结,并研究不同器件的特性。 有文献讨论关于 CZTS/Si 异质结器件的研究,如 文献 [9,19] 利用多源蒸发法通过在 Si 片上外延 生长 CZTS 薄膜制备 CZTS/Si 异质结太阳电池,转 换效率为 5.74%;文献[20] 利用溶胶 - 凝胶法制 备 Al/n-Si/CZTS/Al 异质结光电二极管;文献[21]

通讯作者:梁齐,副教授。

收稿日期:2012-05-10

作者简介:李琳(1988-),女,山东省青岛市人,硕士生。 *基金项目:国家自然科学基金资助项目(51072043)。

制备了 CZTS/a-Si 异质结太阳电池。但还未见研究 PLD 法制备 CZTS/Si 异质结器件以及不同电阻 率衬底材料异质结特性对比的文献。本文利用 PLD 法在不同电阻率的 Si 基片制备 p-CZTS/n-Si 异质结,并研究所制备薄膜的结构、成分和形貌 及器件的光电特性。

1 实验

1.1 异质结器件的结构

利用 PLD 法在 Si 片生长 CZTS 薄膜,制备 p-CZTS/n-Si 异质结,再利用磁控溅射法镀金属电极。之后,对制成的异质结进行表征测试分析。异质结器件的结构如图1所示。



图 1 p-CZTS/n-Si 异质结器件示意图 Fig.1 Schematic of the p-CZTS/n-Si heterojunction device

1.2 异质结器件的制备

利用 PLD 法在不同电阻率的硅片上制备 CZTS 薄膜,实验中使用 n 型 Si(100)衬底材料,其电阻率分 别为 1 Ω · cm~10 Ω · cm 和大于 2000 Ω · cm。制备 CZTS 薄膜所使用靶材是由合肥工业大学化工学 院合成的 CZTS 粉末压制而成的。实验前,将切割 好的 Si 片经丙酮、无水乙醇、去离子水超声清 洗,烘干后,放入 PLD 的沉积室中进行沉积。

实验中 CZTS 薄膜层的生长条件:靶材与衬底的距离是 5 cm,脉冲激光能量为 100 mJ,激光 重复频率为 3 Hz,沉积温度 400℃,沉积时间为 100 min。

CZTS 薄膜层生长结束后再利用磁控溅射法 制备电极,在沉积好的 CZTS 薄膜上沉积 Mo 电 极,在 n 型 Si 衬底上沉积 Al 电极,以制备 CZTS/Si 异质结器件。

实验中 Al 电极的制备参数 溅射功率为 30 W, 溅射气体(Ar)压强为 0.5 Pa,沉积时间为 4 min。Mo 电极的制备参数 :溅射功率为 28 W,溅射气体(Ar) 压强 0.5 Pa,沉积时间为 4 min。

1.3 CZTS 薄膜及异质结器件的表征

使用旋转 Cu 靶 X 射线衍射仪(D/Max-rB,日本 Rigaku 公司)对 CZTS 薄膜进行 X 射线衍射谱的测试,使用扫描电子显微镜(JSM-6490LV,日本电子)对 CZTS 薄膜进行 SEM-EDS 测试,使用扫

<u>描探针显微镜(CSPM4000,本原纳米仪器公司</u>)对 CZTS 薄膜进行表面形貌测试,使用半导体参数 测试仪 (4200-SCS/F,Keithley) 对异质结器件的 I-V 特性进行测试。

2 实验结果与讨论

2.1 CZTS 薄膜的 XRD 分析

图 2 为 CZTS 样品的 XRD 谱图,从图中可以 发现样品分别在 2θ 为 21.307°, 28.563° 47.56° .69.280° 出现衍射峰。由 PDF#26-0575 卡片得 CZTS 分别在 2θ 为 28.530° 与 47.331° 有(112)和(200)衍射峰,而图 2 XRD 谱中的峰位 28.563°和47.56°分别略大于 CZTS 标准衍射 峰 28.530°和 47.331°,这可能是因为此条件下 生长的 CZTS 薄膜存在一定的应力所致衍射峰有 所偏移,因而可以推断图 2 中 2θ 为 28.563°, 47.56°出现的衍射峰为 CZTS(112)和(200)晶面 所对应的衍射峰。在 2θ 为 21.307°出现的衍射 峰对应 S(115)晶面,69.280°的峰为 Si 衬底衍射 所致。在 XRD 图中观察到较强的 CZTS(112)和较 弱的 CZTS(200)衍射峰,说明 CZTS 薄膜有良好的 结晶性,且沿(112)晶面择优取向生长。另外出现 较弱的 S(115)衍射峰,说明薄膜中含有少量硫相 成分。



图 2 CZTS 样品的 XRD 图

 Fig.2 XRD pattern of the CZTS sample

 根据公式 $1/d^2 = (h^2 + k^2)/a^2 + l^2/c^2$,其中 d 为(hkl)

 晶面间距,本实验样品(112)晶面间距d=3.106Å

 (1Å=0.1 nm)。将所测的衍射峰数据代入公式中,

 CZTS 薄膜的晶格常数a=5.81Å ($c \approx 2a$),又由

 Scherrer 公式 $D=k\lambda/\beta cos\theta$,其中 k为 Scherrer 常数 λ

 为 X 射线的波长 β 为半高宽度值 θ 为衍射角的角度

 度 D为晶粒尺寸 经 jade 软件分析,在(112)峰处得到 $\beta=0.513^\circ$, $\theta=14.36^\circ$,代入公式得 D=15.81 nm。

 2.2 CZTS 薄膜的 EDS 分析

图 3 是 CZTS 薄膜的 EDS 图,由 EDS 测量分 析得的原子比如下:Cu/(Zn+Sn)=0.99,Zn/Sn=0.80, S/metal=1.2,这与 CZTS 薄膜标准的化学配比相比, Cu、Zn、Sn 的原子比与标准配比比较接近,而S 的含量偏多。说明 CZTS 薄膜为富硫薄膜。





2.3 CZTS薄膜表面形貌的表征

图 4 为器件表面 CZTS 薄膜的三维 AFM 图像。 图(a)为薄膜的扫描范围为 20 µ m× 20 µ m的三维 形貌图,图(b)为薄膜的扫描范围为 5 µ m× 5 µ m的 三维形貌图。由图 4 可见,薄膜表面除有部分大颗 粒外,其他颗粒比较小,且生长均匀并有良好的 一致取向性。由表面粗糙度和颗粒尺度分析得 知,算数平均粗糙度为 6.47 nm,方均根粗糙度为 10.2 nm,平均颗粒直径为 109 nm。



图 5 为 CZTS 薄膜表面形貌的 SEM 图 ,与图 4 结果基本符合,薄膜表面除有部分大颗粒外, 其他颗粒生长均匀。





2.4 器件的 I-V 特性

图 6 和图 7 是器件中 Si 电阻率分别为 1 Ω · cm ~10 Ω · cm 和大于 2000 Ω · cm 的 I-V 特性曲线, 它们分别是器件在暗环境以及在单位面积光功 率为 0.35 mW/cm² 的白光照射条件下测量的,从 图 6 和图 7 可以看出,在暗环境下,器件的反向 电流很小,而正向电流随电压加大而明显增大, 说明器件具有良好的整流特性。从图中的右上角 小图可以看出,有光照时的曲线经过第四象限, 即当外加电压为 0 V 时有反向电流,说明用脉冲 激光沉积法制备的 p-CZTS/n-Si 的异质结器件有 一定的光伏效应。



图 6 p-CZTS/n-Si(1~10 Ω·cm)异质结器件的 I-V 特性曲线 Fig.6 I-V characteristic curve of p-CZTS/n-Si(1~10 Ω·cm)





图 7 p-CZTS/n-Si(>2000 Ω·cm)异质结器件的 I-V 特性曲线 Fig.7 I-V characteristic curve of p-CZTS/n-Si(>2000 Ω·cm) heterojunction device

对比图 6 和图 7 得,当 Si 的电阻率不同时 得到的器件的 I-V 特性曲线有明显的差异。首 先,图 6 中两条曲线的正向电流比较接近,而反 向电流有所差别,图 7 中两条曲线的正向电流和 反向电流差别比较大,说明 Si 电阻率大的器件的 光电响应比较好。其次从图 6 和图 7 中右上角的 小图可以看出,图 6 中曲线在第四象限包围的面 积比较大,说明在相同的光照条件下,Si 电阻率 小的器件的光伏效应比较好。

本征理想因子 n 可反映 p-n 结中扩散电流与 复合电流的比例关系,与器件的可靠性有密切的 关系,理想情况下 n=1。由公式 $I=I_0[\exp(qV/nkT)-1]$ 得 $n=(q/kT)\times [dV/d(\ln I)]$ 其中, I_0 为饱和电流,k为波尔兹曼常数,n为理想因子,T为绝对温度,q为电子电荷,V是外加电压。经计算得图 6 中器 件的理想因子为 2.2,图 7 中器件的理想因子为 4.3。结果显示 Si 电阻率小的器件理想因子比较 小,这说明两个器件相比之下,Si 电阻率大的器 件比较容易偏离理想状态。

3 结论

在电阻率不同的 n-Si(100)的衬底上用脉冲激 光 沉 积 法 制 备 Cu₂ZnSnS₄ 薄 膜 及 Mo/p-CZTS/n-Si/Al 的异质结器件。薄膜生长状况 良好、颗粒分布均匀,并有良好的结晶性。由 EDS 分析得薄膜的 Cu、Sn、Zn 的原子比接近于标准 原子比,而 S 的含量偏多。由 I-V 特性测试结果 可知,器件有良好的整流特性, Si 电阻率大的器 件光电响应比较好,而 Si 电阻率小的器件光伏 效应比较明显。

参考文献

- Moritake N, Fukul Y, Oonuki M et al. Preparation of Cu₂ZnSnS₄ thin film solar cells under non-vacuum condition[J]. Phys.Status Solidi, 2009,5:1233-1236.
- [2] Moholkar A V, Shinde S S, Babar A R et al. Synthesis and characterization of Cu₂ZnSnS₄ thin films grown by PLD:Solar cells [J].Journal of Alloys and Compounds, 2011,509:7439-7446.
- [3] Pawar S M & B S, Moholkar A V et al. Single step electrosynthesis of Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) thin films for solar cell application [J].Electrochimica Acta, 2010, 55: 4057-4061.
- [4] Chory C, Zutz F, Witt F et al. Synthsis and characterization of Cu_2ZnSnS_4 [J]. Phys. Status Solidi, 2010, 6:1486-1488.
- [5] Araki H, Kubo Y, Jimbo K et al. Preparation of Cu₂ZnSnS₄ thin films by sulfurization of co-electroplated Cu-Zn-Sn precursors [J]. Phys. Status Solidi, 2009,5: 1266-1268.
- [6] Katagiri H. Cu₂ZnSnS₄ thin film solar cells [J]. Thin Solid Films, 2005, 426-432.
- [7] Zhang J, Shao L X, Fu Y J et al. Cu₂ZnSnS₄ thin films prepared by sulfurization of ion beam sputtered precursor and their electrical and optical properties [J]. Rare Metals, 2006:315.
- [8] Zhang J, Shao L X. Cu₂ZnSnS₄ thin films prepared by sulfurizing different multilayer metal precursors [J]. Science China ,2010, 4:474.
- [9] Oishi K, Saito G, Ebine K et al. Growth of Cu₂ZnSnS₄

thin film on Si (100) substrates by multisource evaporation[J]. Thin Solid Films, 2008, 517: 1449-1452.

- [10] Liu F Y, Li Y, Zhang K et al. In situ growth of Cu₂ZnSnS₄ thin films by reactive magnetron co-sputtering [J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2010, 94: 2431-2434.
- [11] Katagiri H, Sasaguchi N, Hando S et al. Preparation and evaluation of Cu₂ZnSnS₄ thin films by sulfurization of E-B evaporated precursors [J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 1997, 49:407-414.
- [12] Fernandes P A, Salome P M P, Cunha A F et al. Growth and Raman scattering characterization of Cu₂ZnSnS₄ thin films [J]. Thin Solid Films,2009, 517: 2519-2523.
- [13] Seol J S,Lee S Y, Lee J C et al. Electrical and optical properties of Cu₂ZnSnS₄ thin films prepared by rf magnetron sputtering process [J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2003,75:155-162.
- [14] Moholkar A V, Shinda S S, Babar A R et al. Development of CZTS thin films solar cells by pulsed laser deposition: Influence of pulse repetition rate [J]. Science Direct, 2011,85:1354-1363.
- [15] Sekiguchi K, Tanaka K, Moriya K et al. Epitaxial growth of Cu₂ZnSnS₄ thin films by pulsed laser deposition[J]. Phys. Stat. Sol. 2006,8: 2618-2621.
- [16] Pawar S M, Moholkar A V, Kim I K et al. Effect of laser incident energy on the structural, morphological and optical properties of Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) thin films [J]. Current Applied Physics, 2010, 10: 565-569.
- [17] Katagiri H, Saitoh K, Washio T et al. Development of thin film solar cell based on Cu₂ZnSnS₄ thin films [J]. Solar Energy Materials & Solar Cells,2001,65:141-148.
- [18] Rajeshmon V G, Kartha C S, Vijayakumar K P et al. Role of precursor solution in controlling the opto-electronic properties of spray pyrolysed Cu₂ZnSnS₄ thin films[J]. Solar Energy, 2011,85:249-255.
- [19] Katagiri H, Jimbo K, Maw W S et al. Development of CZTS-based thin film solar cells [J]. Thin Solid Films, 2009,517:2455-2460.
- [20] Yakuphanoglu F. Nanostructure Cu₂ZnSnS₄ thin film prepared by sol-gel for optoelectronic applications [J]. Solar Energy, 2011, 85: 2518-2523.
- [21] Jiang F, Shen H L, Wang W et al. Preparation and properties of Cu₂ZnSnS₄ absorber and Cu₂ZnSnS₄/amorphous silicon thin-film solar cell [J]. Applied Physics Express,2011,4: 074101.